(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出屬公開番号 特開2000-117902

(P2000-117902A)

(43)公開日 平成12年4月25日(2000.4.25)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコート*(参考)
B32B	27/00	101	B32B 2	27/00	101	2 K 0 O 9
C081	5/18		C 0 8 J	5/18		4F071
G02B	1/10		C 0 9 D 18	33/00		4F100
// C09D	183/00		G 0 2 B	1/10	Z	4J038

審査請求 未請求 請求項の数30 OL (全 14 頁)

(21)出願番号	特顏平10-289564	(71) 出願人	000003159	
			東レ株式会社	
(22)出願日	平成10年10月12日(1998.10.12)	東京都中央区日本橋室町2丁目2番1-		
		(72)発明者	近藤 哲司	
			滋賀県大津市岡山1丁目1番1号 東レ株	
			式会社滋賀事業場内	
		(72) 発明者	岡 紘一郎	
			滋賀県大津市関山1丁目1番1号 東レ株	
			式会社滋賀事業場内	
		1		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 シートまたはフィルム

(57)【要約】

【課題】汚れが付着しにくく、かつ汚染物の除去が容易なシートまたはフィルムを提供する。

【解決手段】カチオン性重合基を有する化合物を硬化して得られた有機系被膜を表面に形成したシートまたはフィルム上に、下記一般式で示される含フッ素シラン化合物を含有する組成物を硬化してなる被膜を有することを特徴とするシートまたはフィルム。 【化1】

> $Rf - R^3 - Si - (R^2)_n$ $(R^1)_{3-n}$

(式中、R f は炭素数 $1\sim10$ の直鎖状あるいは分岐状パーフルオロ基あるいはハイドロパーフルオロ基、R 1 は加水分解可能な基、R 1 は一価の有機基、R 1 は二価の有機基、1 は 1 ない 1 の整数を表す。)

* (式中、Rfは炭素数1~10の直鎖状もしくは分岐状

水酸基あるいは加水分解可能な基、R'は一価の有機

基、R'は二価の有機基、nは0~2の整数を表す。) 【請求項2】含フッ素シラン化合物が、下記一般式で示

される請求項1記載のシートまたはフィルム。

パーフルオロ基またはハイドロパーフルオロ基、R¹は

【特許請求の範囲】

【請求項1】カチオン性重合基を有する化合物を硬化し て得られた有機系被膜を表面に形成したシートまたはフ ィルム上に、下記一般式で示される含フッ素シラン化合 物を含有する組成物を硬化してなる被膜を有することを 特徴とするシートまたはフィルム。

1

- 【化1】

$$Rf - R^3 - Sj - (R^2)_n$$

 $(R^1)_{3-n}$

*10

[{k2]

(式中、Rfは炭素数1~10の直鎖状もしくは分岐状 のパーフルオロ基またはハイドロパーフルオロ基、Xは フッ素原子、ヨウ素原子、臭素原子、塩素原子および水 素原子から選ばれる少なくとも1つ、Yは水素原子また 20 mは1~20の整数、nは0~2の整数を表す。) は炭素数1~10の低級アルキル基、 Zはフッ素原子、 炭素数1~16の直鎖状もしくは分岐状のパーフルオロ 基またはハイドロパーフルオロ基、R'は水酸基あるい ※

※は加水分解可能な基を表す。R'は一価の有機基、a,b, c.dはそれぞれ0~200の整数であって、1≦a+b+c+d **≦200である。eは0または1、1は0~3の整数、** 【請求項3】含フッ素シラン化合物が、下記一般式で示 される請求項1記載のシートまたはフィルム。 [1L3]

(式中、Xは水素原子またはヨウ素原子、Yは水素原子 30 するシートまたはフィルム。 または炭素数1~10の低級アルキル基、R1は水酸基 あるいは加水分解可能な基である。aは1~100の整 数、1は0~3の整数、mは1~20の整数、nは0~ 2の整数を表す。R'は一価の有機基を表す。)

【請求項4】有機系被膜がハードコート膜であることを 特徴とする請求項1から3のいずれかに記載のシートま たはフィルム。

【請求項5】有機系被膜が帯電防止性能を有する導電性 ハードコート膜であることを特徴とする請求項1から4 のいずれかに記載のシートまたはフィルム。

【請求項6】有機系被膜が表面に微細な凹凸を有する防 **眩性ハードコート膜であることを特徴とする請求項1か** ら5のいずれかに記載のシートまたはフィルム。

【請求項7】請求項5または6に記載の帯電防止性能を 有する導電性ハードコート膜が、導電性を有する無機酸 化物微粒子を分散させたものであることを特徴とするシ ートまたはフィルム。

【請求項8】請求項7記載の導電性を有する無機酸化物 微粒子が、スズ、インジウム、アンチモンおよび亜鉛か らなる群から選ばれる成分を含有していることを特徴と 50

【請求項9】請求項7記載の導電性を有する無機酸化物 微粒子が、アンチモン酸亜鉛微粒子を含有することを特 徴とするシートまたはフィルム。

【請求項10】請求項6~9のいずれかに記載の表面に 微細な凹凸を有する防眩性ハードコート膜が 1 次平均粒 子径または2次平均粒子径が1μm~7μmの微粒子を 分散させたものであることを特徴とするシートまたはフ

【請求項11】請求項10記載の微粒子が、シリカ、酸 化アルミニウム、酸化マグネシウムおよび炭酸カルシウ ムから選ばれる無機化合物微粒子あるいは有機化合物の 球状微粒子であることを特徴とするシートまたはフィル

【請求項12】カチオン性重合基が、エポキシ基または ビニルエーテル基である請求項1~11のいずれかに記 載のシートまたはフィルム。

【請求項13】有機系被膜が反射防止機能を有する低屈 折率光学薄膜であることを特徴とする請求項1から3の いずれかに記載のシートまたはフィルム。

【請求項14】反射防止機能を有する低屈折率光学薄膜

がフッ素化合物及び有機珪素化合物を主成分とする組成 物を硬化してなる樹脂によって形成される請求項13記 載のシートまたはフィルム。

【請求項15】前記フッ素化合物の一部または全部が2 つ以上のエポキシ基あるいはビニルエーテル基を有し、 熱または活性光線で硬化されることを特徴とする請求項 14に記載のシートまたはフィルム。

【請求項16】前記フッ素化合物が下記構造を有すると とを特徴とする請求項15記載のシートまたはフィル ٨.

Ep-CH, -(0), -(CH,), -(CF,), -(CH,), -(0), -CH, -Ep ただし、Epはエポキシ基、aは0~1、bは0~2、c は2~12、dは0~2、eは0~1の整数を表す。

【請求項17】前記フッ素化合物が下記構造を有するフ ッ素含有ビニルエーテル

- 化合物であるととを特徴とする請求項14記載のシート またはフィルム。

 $CH_k = CRO(CH_k)_f (CF_k)_a (CH_k)_h OCR = CH_k$

ただし、RはHまたはCH₃、fは0~2、gは2~1 2、hは0~2の整数を表す。

【請求項18】前記有機珪素化合物が下記構造を有する ことを特徴とする請求項14から17のいずれかに記載 のシートまたはフィルム。

 $Si(R1)_1(R2)_1(R3)_k(OR4)_{4-(1+1+k)}$

ただし、R1、R2、R3は炭素、水素、酸素、窒素お よびフッ素原子から選ばれる少なくとも1つを含む有機 基を、R4は脂肪族、脂環族および芳香族残基から選ば れる置換基を、iはOまたは1、jはOまたは1、kは 0または1の整数をそれぞれ表す。

【請求項19】請求項18記載の有機珪素化合物を部分 30 加水分解したことを特徴とするシートまたはフィルム。

【請求項20】請求項18記載の有機珪素化合物を部分 加水分解し、硬化したことを特徴とするシートまたはフ ィルム。

【請求項21】請求項18記載の有機珪素化合物におい て、R1、R2、R3の少なくともいずれか一つに重合 性官能基を有することを特徴とするシートまたはフィル

【請求項22】請求項21記載の有機珪素化合物が、エ 線で硬化されていることを特徴とするシートまたはフィ ルム。

【請求項23】請求項22記載の有機珪素化合物が、下 記構造であることを特徴とするシートまたはフィルム。 (Ep-CH, O(CH,),), Si(RS), (R6), (OR7), (CF, 1)

ただし、Epはエポキシ基、R5、R6は炭素、水素、酸 素およびフッ素原子から選ばれる少なくとも1つを含む 有機基を、R7は脂肪族、脂環族および芳香族残基から 選ばれる少なくとも1つを、gは0~4、rは0~3、 sは0~3、tは0~3の整数をそれぞれ表す。

【請求項24】請求項22記載の有機珪素化合物が、下 記構造であることを特徴とするシートまたはフィルム。

 $(CH_k = CRO(CH_k)_u)_v Si(R8)_w (R9)_x (OR10)_{4-(v+v+x)}$ ただし、R8、R9は炭素、水素、酸素およびフッ素原

子から選ばれる少なくとも1つを含む有機基を、R10 は脂肪族、脂環族および芳香族残基から選ばれる少なく とも一つを、uは0~4、vは0~3、wは0~3、xは0 ~3の整数をそれぞれ表す。

【請求項25】請求項14記載の反射防止機能を有する 低屈折率光学薄膜が、該樹脂に微粒子を添加することに よって、膜中にミクロ空隙を形成させたものであるシー トまたはフィルム。

【請求項26】請求項25記載の微粒子が、少なくとも Si、Al、Sn、Sb、ZnおよびTiから選ばれる 1種以上の元素を含む金属酸化物か、フッ化マグネシウ ム又はフッ化カルシウムであることを特徴とするシート またはフィルム。

【請求項27】請求項25記載の微粒子が、BET法で 測定した平均粒子径が1~100 n m であることを特徴 20 とするシートまたはフィルム。

【請求項28】請求項13から27記載の低屈折率光学 薄膜がハードコート膜の上に形成されたことを特徴とす るシートまたはフィルム。

【請求項29】請求項28記載のハードコート膜が低屈 折率光学薄膜よりも屈折率が高いことを特徴とするシー トまたはフィルム。

【請求項30】請求項28記載のハードコート膜が請求 項4から12のいずれかに記載のハードコート膜である ことを特徴とするシートまたはフィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 CRTディスプレーやLCD ディスプレーなどの表示画面あるいは展示用のケースや ショーウインドウ、絵画の額などに使用される光学物品 として好適に用いられ、汚れが付着しにくく、かつ汚染 物の除去が容易なシートまたはフィルムに関する。

[0002]

【従来の技術】表示装置や展示用のケースやショーウイ ンドウ、絵画の額などに使用される表面は指紋などの汚 ボキシ基又はビニルエーテル基を有し、熱または活性光 40 れが付着しやすく、透明性や反射性を損なうため、表面 に撥水・撥油性の塗膜を形成させる方法で改善する試み がなされている。このような防汚層を得る方法として は、蒸着やスパッタなどによって撥水撥油性の塗膜を形 成させるのが一般的であり、このようにして得られる防 汚層は耐擦傷性に優れる傾向がある。しかし、蒸着やス バッタして防汚処理する方法は高耐久性の防汚層が得ら れやすいものの、真空を必要とする大がかりな装置を用 いるので生産性が悪く、製造コストは髙価であった。ま た、これらの方法は、蒸着もしくはスパッタ時に基板が 50 80°C以上に加熱されるので、耐熱性の点などから使用

できる基板が限定されていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】表示装置や展示用のケースやショーウインドウ、絵画の額などに使用されるシートやフィルムは人が使用するに際し、指紋、マジック、化粧、汗などの汚れが付着しやすく、一度付着するとその汚れは除去しにくい。

【0005】そのため本発明では、上記従来技術の欠点を解消した非常に簡便な手法により形成することのできる、汚れが付着しにくく、かつ汚染物の除去が容易なシートやフィルムを提供するものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達 20 することを目的とし、次の構成を有する。

【0007】「カチオン性重合基を有する化合物を硬化して得られた有機系被膜を表面に形成したシートまたはフィルム上に、下記一般式で示される含フッ素シラン化合物を含有する組成物を硬化してなる被膜を有することを特徴とするシート又はフィルム。.

[0008]

[化4]

$$Rf - R^3 - Si - (R^2)_n$$

(式中、Rf は炭素数 $1\sim10$ の直鎖状あるいは分岐状パーフルオロ基あるいはハイドロパーフルオロ基、 R^1 は加水分解可能な基、 R^2 は一価の有機基、 R^3 は二価の有機基、 R^3 は二価の有機基、 R^3 は二価の

[0009]

[発明の実施の形態]本発明ではさらに次の好ましい実施様態を有している。

【0010】(a)前記有機系被膜がハードコート膜であることを特徴とするシートまたはフィルムであること

【0011】(b)前記有機系被膜が帯電防止性能を有する導電性ハードコート膜であることを特徴とするシートまたはフィルムであること。

【0012】(c)前記有機系被膜が表面に微細な凹凸を有する防眩性ハードコート膜であることを特徴とするシートまたはフィルムであること。

【0013】(d)前記有機系被膜が表面に微細な凹凸 ニルエーテル、2-メチル-1,3-プロパンジオールを有し、さらに帯電防止性能を有する防眩性導電性ハー ジビニルエーテル、ジエチレングリコールジビニルエードコート膜であることを特徴とするシートまたはフィル 50 テル、ブタンジオールジビニルエーテル、ヘキサンジオ

ムであること。

【00.1.4】—(-e.) 前記有機系被膜が反射防止機能を有する低屈折率光学薄膜であることを特徴とするシートまたはフィルムであること。

【0015】(f)前記低屈折率光学薄膜がハードコート膜の上に形成されたことを特徴とするシートまたはフィルムであること。

【0016】(g)前記ハードコート膜が低屈折率光学 薄膜よりも屈折率が高いことを特徴とするシートまたは 10 フィルムであること。

【0017】本発明で適用されるシートまたはフィルムは、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ポリカーボネート(PC)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、トリアセチルセルロース(TAC)、ジエチレングリコールピスアリルカーボネート、ポリエーテルスルホン(PES)、マレイミド系樹脂、スチレン/アクリロニトリル共重合体、ポリアクリレート、ジアセチルセルロース、ポリエーテルサルホン、ポリエーテルサトセルロース、ポリエーテルサルホン、ポリエーテルケトンフィルム、ポリエーテルケトンフィルム、ポリエーテルケトンフィルム等のシートまたはフィルムがある。なかでもポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ジスチレングリコールピスアリルカーボネート、ポリエーテルサル

[0018]次に、本発明の有機系被膜は、カチオン性 重合基を有する有機系化合物を含む組成物を上記シート またはフィルムへ塗布、硬化したものである。。 カチオ ン性重合基としては、例えばエポキシ基、ビニルエーテ 30 ル基、ビニル基、スチレン基、、N-ビニルカルパゾー ル基などが挙げられる。

ホン、トリアセチルセルロースなどは光学用途に使用されるシートまたはフィルムに好ましく適用される。

【0019】エポキシ基またはピニルエーテル基等のカ チオン性重合基は硬化の際に硬化収縮が起こりにくく、 クラックなどが起こりにくい特徴がある。本発明におけ るエポキシ基を有する化合物としては、例えば、脂肪 族、脂環族、芳香族系単官能エポキシ化合物、プロピレ ングリコールジグリシジルエーテル、ヘキサヒドロビス フェノールA系ジグリシジルエーテル、ビスフェノール A系ジグリシジルエーテル、フタル酸ジグリシジルエス 40 テル、ダイマー酸ジグリシジルエステル等の2官能エポ キシ化合物、トリグリシジルイソシアネート、テトラグ リシジルジアミノジフェニルメタン、クレゾールノボラ ックポリグリシジルエーテルなどの3官能あるいはそれ 以上のエポキシ化合物、エポキシ基含有シラン系化合物 などがあげられる。また、ビニルエーテル基を有する化 合物としては例えば、脂肪族、脂環族、芳香族系単官能 ビニルエーテル化合物、1、3-プロパンジオールジビ ニルエーテル、2-メチル-1,3-プロパンジオール ジビニルエーテル、ジエチレングリコールジビニルエー

8

ールジビニルエーテル等の2官能あるいはそれ以上のビニルエーテル化合物、ビニルエーテル基含有シラン系化合物などがあげられる。その他にカチオン性重合基を有する有機系化合物の例としては、スチレン、αーメチルスチレン、pーメトキシスチレン、Nービニルカルバゾールなどが挙げられる。

【0020】硬化剤としてはカチオン付与系の化合物が 好ましく用いられる。カチオン付与系の化合物として は、プロトン酸、酸性ハロゲン化金属、有機金属化合 物、安定なカルボニウムイオン塩などが挙げられる。中 10 でも光分解カチオン付与系の化合物がポットライフの長 さ、硬化速度の速さから硬化に適しており、芳香族ジア ゾニウム塩、ジアリルヨードニウム塩、トリアリルスル ホニウム塩、トリアリルセレノニウム塩、トリアリルビ リジニウム塩、ベンジルビリジニウムチオイソシアネー 。ト、ジアルキルフェナシルスルホニウム塩、ジアルキル ヒドロキシフェニルスルホニウム塩、ジアルキルヒドロ キシフェニルホスホニウム塩およびメタロセン化合物な どが単体もしくは混合して用いられる。この他、エポキ シ基の硬化剤として酸無水物類、アミン類、アミド類、 フェノール類、(ポリ)メルカプト化合物、イミダゾー ル類アルミニウム、鉄、銅など金属キレート化合物、例 えば、アルミニウムアセチルアセトネート、アルミニウ ムビスエチルアセトアセテートモノアセチルアセトネー*

* ト、アルミニウムージーn ープトキシドモノエチルアセ ―-トアセテート、アルミニウムージーisoープロボキシ ドモノエチルアセトアセテートなどの化合物がエボキシ 系化合物の硬化剤として使用される。

【0021】 これらの硬化剤はエポキシ化合物あるいは ビニルエーテル化合物合計 100重量部に対し、0.1 ~20重量程度が用いられるこのような有機系被膜を表 面に形成したシートまたはフィルム上に、下記一般式で 示される含フッ素シラン化合物を含有する組成物をコー ティングして目的とするシートまたはフィルムを得る。 【0022】

【化5】

$$Rf - R^3 - Si - (R^2)_n$$

 $(R^1)_{3-n}$

(式中、Rfは炭素数1~10の直鎖状もしくは分岐状パーフルオロ基またはハイドロパーフルオロ基、R'は水酸基または加水分解可能な基、R'は一価の有機基、20 R'は二価の有機基、nは0~2の整数を表す。)上記含フッ素シラン化合物として好ましい物として下記一般式で示される化合物などが挙げられる。

[0023]

【化6】

$$C_3F_7$$
— $(OCF_2CF_2CF_2)_{\bullet}$ — 0 — $(CF_2)_2$ — $(CH_2$ — C — $)_m$ - χ
 $(CH_2)_1$
 S_1 - R^2_n
 R^1_{3-n}

(式中、Xは水素原子またはヨウ素原子、Yは水素原子または炭素数1~10の低級アルキル基、R¹は水酸基あるいは加水分解可能な基である。aは1~100の整数、1は0~3の整数、mは1~20の整数、nは0~2の整数を表す。R¹は一価の有機基を表す。) これらのパーフルオロボリエーテル鎖を持つ化合物は例えば特開平1-294709で開示されている方法で得ることができる。

【0024】上記含フッ素シラン化合物を含有する組成物をコーティングするためには有機系被膜上にスピンコート、ディップコート、ダイコート、スプレーコート、バーコート、ロールコート、カーテンフローコート、グラビアコートなどの方法により塗布し、溶媒を除去し、50必要に応じて室温あるいは加熱して硬化する。使用する

(6)

溶媒としてはパーフルオロヘキサン、パーフルオロオクタン、トリフルオロキシレシ等のジッ素系の溶媒が好ましい。また、加水分解し、シロキサン結合による部分的な縮合を促進するために、純水または塩酸、酢酸、リン酸、硝酸あるいは硫酸などの酸性水溶液あるいは硬化促進のためアルミニウムアセチルアセトナートなどの金属・アルコキシドを添加していても構わない。その他に、表面改質剤(フッ素系界面活性剤、シリコン系界面活性剤など)、Si、A1、Sn、Sb、Zn、Tiの酸化物やフッ化マグネシウム、フッ化カルシウムなどの微粒子、ポリテトラフルオロエチレン等のフッ素樹脂、エチルシリケート、パーフルオロオクチルエチルトリメトキシシラン等の有機珪素化合物あるいはその加水分解物を添加しても良い。

【0025】含フッ素シラン化合物を含有するコーティング被膜の膜厚としては、好ましくは1nmから100nm、より好ましくは10nmから50nmが好ましい、膜厚が1nmより薄いと防汚性の効果が不十分となり、100nmより厚いと膜強度が弱くなる傾向がある。

【0026】本発明の有機系被膜をハードコート膜として使用する際には、膜厚は、通常0.5~10μm程度にすることにより、ハードコート本来の性能の耐擦傷性機能付与とその他の性能(例えばクラック発生防止)とのバランスがとれる。

【0027】また、このような有機系被膜のハードコー ト膜に導電性を有する無機酸化物微粒子を固形分全体に 対し40~90重量%、好ましくは50~80重量%分 散させることにより導電性のハードコート膜とすること ができる。その際、10¹⁰~10 Ω/□程度の導電性が 30 あれば、帯電防止機能や、さらには電磁波遮断機能が付 与できる。無機酸化微粒子が40重量%未満では導電性 が不足し、また90重量%を越えると被膜の強度が低下 する傾向がある。とのような無機酸化微粒子としてはス ズ、インジウム、アンチモン、亜鉛の群の中から選ばれ る成分を含有しているものがあげられる。例えば酸化ア ンチモン、酸化セレン、酸化チタン、酸化スズ、アンチ モンドープ酸化スズ、リンドープ酸化スズ、酸化亜鉛、 アンチモン酸亜鉛、スズドープ酸化インジウムなどがあ げられるが、特にアンチモン酸亜鉛が帯電防止性、膜の 40 透過率の点から好ましい。

【0028】また、有機系被膜のハードコート膜に微粒子を分散させて表面に凹凸を形成させ表面光沢を減少することも反射防止の面から好ましい。このような表面に凹凸を形成させ表面光沢を減少させる微粒子としては、1次平均粒子径または2次粒子径が1 μ m \sim 7 μ mの微粒子が好ましい。1 μ m未満だと表面光沢が減少せず、7 μ mを越えると透過率が不十分となる傾向がある。微粒子は固形分全体に対し好ましくは1 \sim 10 \pm \pm \pm \pm \pm 50

量%未満だと光沢が減少しにくく、また10重量%を越えると透過率が悪くなる傾向がある。 微粒子としてはシリカ、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、炭酸カルシウムなど無機化合物微粒子あるいは有機化合物の球状微粒子などがあげられる。特にシリカ微粒子は防汚コーティングである含フッ素シラン化合物との密着性の点から好ましいまた、上記導電性を有する無機酸化物微粒子と表面に凹凸を形成させ表面光沢を減少するような微粒子を2種類以上分散させ、帯電防止機能を有する防眩性 導電性ハードコート膜とすることも有効である。

【0029】本発明の有機系被膜が低屈折率を有し、光 学薄膜の場合は、反射防止機能を有することができる。 光学薄膜とは、上部に薄膜が存在している基材に光線が 入射したとき、光線が屈折率の異なる境界で交差して干 渉を起こす薄膜をいう。光学薄膜では、反射光は入射光 の干渉光として出現する。例えば、透明な基板上に透明 な光学薄膜を一層設けたとき、入射反射光の一部は空気 と薄膜との境界で反射し、一部は薄膜と基板界面で反射 し、全体として反射光はそれらの干渉光となる。干渉光 は結果的に基材の反射率を低減もしくは増加させる。光 学薄膜は、光が干渉作用をおこす程度に薄く、基板の反 射率は光学薄膜の屈折率と膜厚に依存し、光学薄膜の膜 厚はλ/4ηの奇数倍が好ましい。 ここでは、λは薄膜 内での光の波長を示し、光の波長がある程度の幅で存在 している場合は、λは光の中心波長を示す。 n は膜屈折 率を表す。本発明で対象となる光の波長は、多くの場合 可視光であり、中心波長は通常人間の感じる500~5 50 nmに設定するのが好ましい。

【0030】とのような光学薄膜の膜厚は、膜の屈折率にもよるが、可視光における光干渉による反射率の低減効果を発揮させる観点から、好ましくは $70\sim700n$ m、より好ましくは、 $80\sim120nm$ 、さらに好ましくは、 $90\sim110nm$ である。反射防止効果を持たせる観点から、光学薄膜の屈折率を1.45以下、さらに1.42以下とすることが好ましい。

【0031】本発明で使用する反射防止機能を有する低屈折率光学薄膜としてはフッ素化合物及び有機珪素化合物を主成分とする組成物を硬化してなる樹脂によって形成される。そのなかでもフッ素化合物の一部または全部が2つ以上のエポキシ基あるいはビニルエーテル基をもつ含フッ素化合物であれば、フッ素原子を有するため化合物の屈折率が低く、熱または活性光線によりカチオン重合により硬化を行なうことができる。このため硬化速度が速く、硬化による収縮が起きないため、硬化による屈折率の上昇もおきにくい。また、2つ以上のエポキシ基あるいはビニルエーテル基を持つことにより高い架橋密度をもつため、表面硬度が高く、シートまたはフィルムとの密着性もよく、耐擦傷性に優れた低屈折率層を形成することができる。

こ 【0032】また、有機珪素化合物を含むことは防汚層

である含フッ素シラン化合物のコーティング被膜とシロ ... キサン結合により化学的に結合できるため耐擦傷性の面 から考えて好ましい。

【0033】以上のようなエポキシ基を含有するフッ素 化合物の例としては、脂肪族、脂環式、芳香族系フッ素 含有単官能エポキシ化合物、例えば、ヘキサフルオロエ ポキシプロパン、3-パーフルオロブチル-1,2-エ ポキシプロパン、3-パーフルオロヘキシル-1,2-エポキシプロパン、3-パーフルオロオクチル-1,2 -エポキシプロパン、3-パーフルオロデシル-1,2 10 -エポキシブロパン、3-(パーフルオロ-3-メチル ブチル)-1,2-エポキシプロパン、3-(パーフル オロ-5-メチルヘキシル)-1,2-エポキシプロバ ン、3-(パーフルオロ-7-メチルオクチル)-1, 2-エポキシプロパン、3-(パーフルオロ-9-メチ ルデシル)-1,2-エポキシプロパン、3-(2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロポキシ)-1, 2-エ ポキシプロパン、3-(1H, 1H, 5H-オクタフル 「オロペンチルオキシ)-1、2-エポキシプロパン、3 - (1H, 1H, 7H-ドデカフルオロヘプチルオキ シ) -1, 2-エポキシブロパン、3-(1H, 1H, 9H-ヘキサデカフルオロノニルオキシ)-1,2-エ ポキシプロパン等が挙げられる。エポキシ基を含有する フッ素化合物のなかでも特に好ましく用いられるのは、 多官能フッ素含有エポキシ化合物類であり、その例とし ては、下記構造式で示されるエポキシ化合物類が挙げら れる。

[0034]

 $Ep - CH_1 - (0)_1 - (CH_2)_2 - (CH_2)_3 - (0)_4 - CH_4 - Ep$ (ただし、Epはエポキシ基、a=0~1、b=0~2、 c=2~12、d=0~2、e=0~1の整数を表 す。) なお、上式において、cは好ましくは2以上12 以下の整数であり、屈折率を低減させ、硬さと低屈折率 性を保持するために、 cは4以上10以下とするのが好

【0035】その他架橋密度を上げるために、脂肪族、 脂環式、芳香族系単官能エポキシ化合物、エチレングリ コールジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコール ジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシ ジルエーテル、ポリプロピレングリコールジグリシジル 40 ととで、R1、R2、R3は炭素、水素、酸素又はフッ エーテル、ヘキサヒドロビスフェノールA型ジグリシジ ルエーテル、(水添)ビスフェノールA型ジグリシジル エーテル、2,2-ジプロモネオペンチルグリコールジ グリシジルエーテル、グリセリンジグリシジルエーテ ル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル、 フタル酸ジグリシジルエステル、ダイマー酸ジグリシジ ルエステル、トリグリシジルイソシアヌレート、テトラ グリシジルアミノジフェニルメタン、クレゾールノボラ ックポリグリシジルエーテル等の多官能エポキシ化合

できる。

【0036】また、ビニルエーテル基を持つフッ素化合 物としては、脂肪族、脂環式、芳香族系フッ素含有単官 能ビニルエーテル化合物の他、以下のような構造をも つ、多官能化合物が架橋密度を上げるため好ましく用い られる。

[0037] CH, =CRO(CH,), (CF,), (CH,), OCR=CH, (ただし、RはHまたはCH3、fは0~2、gは2~ 12、hは0~2の整数を表す。) その例として以下の ような構造をもつものが挙げられる。

[0038]

CH = CH-O-CH, -O-(CF,)k-O-CH, -O-QH=CH, CH = CH-O-CH -O-(CH,), -(CF,), -(CH,), -O-CH, -O-CH=CH, $CH_1 = CH - O - CH_2 - O - (CH_2)_3 - (CF_2)_3 - (CH_2)_3 - O - CH_2 - O - CH_2 -$ CH = CH-0-(CH,), -0-(CF,), -0-(CH,), -0-CH=CH, CH = CH-0-(CH,), -0-CH, -(CF,), -CH, -0-(CH,), -0-CH-CH, $CH_{+}CH_{-}C(CH_{+})_{1}-C(CH_{+})_{2}-(CF_{2})_{4}-(CH_{+})_{2}-C(CH_{+})_{2}-C(CH_{+})_{3}-C(CH_{+})_{4}$ CH2+CH₂

20 Ct₂ =CH-O-(Ct₁)₂ -O-(Ct₂)₃ -(Ct₂)₃ -(Ct₄)₃ -O-(Ct₄)₂ -O-CH=CH₂

(なお、上記式において、kは好ましくは2以上12以 下の整数であり、屈折率を低減させ、ある程度の硬さを 保持するために、kは4以上10以下とするのが好まし い。)また架橋密度をあげるためにフッ素を含まないビ ニルエーテル化合物、例えば、脂肪族、脂環族、芳香族 系単官能ピニルエーテル化合物、1、3-プロパンジオ ールジビニルエーテル、2-メチル-1,3-プロパン ジオールジビニルエーテル、ジエチレングリコールジビ 30 ニルエーテル、ブタンジオールジピニルエーテル、ヘキ サンジオールジビニルエーテル等の2官能あるいはそれ 以上のビニルエーテル化合物、ビニルエーテル基含有シ ラン系化合物などを加えることもできる。

【0039】さらに、本発明の反射防止機能を有する低 屈折率膜に用いられる有機珪素化合物の例としては、一 般に下記構造で示されるものが架橋構造を形成しろる点 で好ましく、一種類あるいは2種類以上添加することも 可能である。

[0.04.0] Si(RL), (R2), (R3), (OR4), (1+1+k) 素原子を含む有機基を、R4は加水分解性基を、i=0 または1、jは0または1、kは0又は1の整数をそれ ぞれ表す。例としては、メチルシリケート、エチルシリ ケート、n - プロピルシリケート、i - プロピルシリケ ート、n-ブチルシリケート、sec-ブチルシリケー・ トおよび t - ブチルシリケートなどのテトラアルコキシ シラン類、さらにはメチルトリメトキシシラン、メチル トリエトキシシラン、メチルトリアセトキシシラン、メ チルトリプトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、 物、エポキシ基含有シラン系化合物などを加えることも 50 エチルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラ



ン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリアセトキシ シラン、ビニルトリメトキシエトキシシラン、ビニルジ メチルエトキシシラン、ビニルメチルジエトキシシラ ン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキ シシラン、フェニルトリアセトキシシラン、ィークロロ プロピルトリメトキシシラン、ケークロロプロピルトリ 。 エトキシシラン、ケークロロプロピルトリアセトキシシ ラン、3、3、3-トリフロロプロピルトリメトキシシ ラン、γ-メタクリルオキシプロピルトリメトキシシラ ン、_アーアミノプロピルトリメトキシシラン、アーアミ 10 シラン類およびジメチルジメトキシシラン、フェニルメ ノプロピルトリエトキシシラン、ャーメルカプトプロピ ルトリメトキシシラン、ケーメルカプトプロピルトリエ トキシシラン、 $N-\beta-$ (アミノエチル) $-\gamma-$ アミノ プロピルトリメトキシシラン、βーシアノエチルトリエ トキシシラン、メチルトリフェノキシシラン、クロロメ 。チルトリメトキシシラン、クロロメチルトリエトキシシ ラン、グリシドキシメチルトリメトキシシラン、グリシ ドキシメチルトリエトキシシラン、αーグリシドキシエ チルトリメトキシシラン、α-グリシドキシエチルトリ エトキシシラン、βーグリシドキシエチルトリメトキシ 20 シラン、βーグリシドキシエチルトリエトキシシラン、 α - β リシドキシプロピルトリメトキシシラン、 α - β リシドキシプロピルトリエトキシシラン、βーグリシド キシプロピルトリメトキシシラン、βーグリシドキシプ ロピルトリエトキシシラン、ャーグリシドキシプロピル トリメトキシシラン、ァーグリシドキシプロピルトリエ トキシシラン、ジエトキシー3-グリシドキシプロピル メチルシラン、ジメトキシ-3-グリシドキシプロピル メチルシラン、3-グリシドキシプロピルジメトキシシ ラン、ァー(メタ)アクリロイルオキシプロピルジメチ 30 ルエトキシシラン、ャー(メタ)アクリロイルオキシブ ロビルメチルジエトキシシラン、ケーグリシドキシプロ ピルトリプロポキシシラン、ャーグリシドキシプロピル トリプトキシシラン、ケーグリシドキシプロピルトリメ トキシエトキシシラン、ケーグリシドキシプロピルトリ フェノキシシラン、 α--グリシドキシブチルトリメトキ シシラン、αーグリシドキシブチルトリエトキシシラ ン、β-グリシドキシブチルトリメトキシシラン、β-グリシドキシブチルトリエトキシシラン、ャーグリシド キシブチルトリメトキシシラン、ャーグリシドキシブチ 40 ラン、ャーグリシドキシプロビルビニルジメトキシシラ ルトリエトキシシラン、δーグリシドキシブチルトリメ トキシシラン、 8ーグリシドキシブチルトリエトキシシ ラン、(3,4-エポキシシクロヘキシル)メチルトリ メトキシシラン、(3,4-エポキシシクロヘキシル) メチルトリエトキシシラン、βー(3,4-エポキシシ クロヘキシル) エチルトリメトキシシラン、 β ー(3, 4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリエトキシシラ ン、 β - (3, 4 - エポキシシクロヘキシル) エチルトリプロポキシシラン、β-(3,4-エポキシシクロへ キシル) エチルトリプトキシシラン、βー(3,4 – エ 50 so-プロポキシシラン、テトラペンターn-プロポキ

ポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシエトキシシラン、β--(-3,-4-エポキシシクロヘキシル) エチル トリフェノキシシラン、ャー(3,4-エポキシシクロ ヘキシル) プロピルトリメトキシシラン、ケー(3,4 -エポキシシクロヘキシル) プロビルトリエトキシシラ ン、 δ ー(3, 4-エポキシシクロヘキシル) ブチルト リメトキシシラン、δー(3,4-エポキシシクロヘキ シル) ブチルトリエトキシシランなどのトリアルコキシ シラン、トリアシルオキシシランまたはトリフェノキシ チルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、フ ェニルメチルジエトキシシラン、アークロロプロピルメ チルジメトキシシラン、アークロロプロビルメチルジェ トキシシラン、ジメチルジアセトキシシラン、ケーメタ クリルオキシプロピルメチルジメトキシシラン、ケーメ タクリルオキシプロピルメチルジエトキシシラン、ャー メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、ケーメル カプトプロビルメチルジエトキシシラン、ャーアミノブ ロビルメチルジメトキシシラン、ケーアミノプロビルメ チルジエトキシシラン、メチルビニルジメトキシシラ ン、メチルビニルジエトキシシラン、グリシドキシメチ ルメチルジメトキシシラン、グリシドキシメチルメチル ジエトキシシラン、αーグリシドキシエチルメチルジメ トキシシラン、αーグリシドキシエチルメチルジエトキ シシラン、β-グリシドキシエチルメチルジメトキシシ ラン、βーグリシドキシエチルメチルジエトキシシラ ン、αーグリシドキシプロピルメチルジメトキシシラ ン、αーグリシドキシプロピルメチルジエトキシシラ ン、β-グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラ ン、βーグリシドキシプロピルメチルジェトキシシラ ン、γーグリシドキシプロピルメチルジメトキシシラ ン、アーグリシドキシプロビルメチルジエトキシシラ ン、ァーグリシドキシプロピルメチルジプロポキシシラ ン、ァーグリシドキシプロピルメチルジブトキシシラ ン、γ-グリシドキシプロピルメチルジメトキシエトキ シシラン、ャーグリシドキシプロピルメチルジフェノキ シシラン、ャーグリシドキシブロピルエチルジメトキシ シラン、ケーグリシドキシプロピルエチルジエトキシシ ラン、ケーグリシドキシプロピルエチルジプロポキシシ ン、アーグリシドキシプロピルビニルジエトキシシラ ン、アーグリシドキシプロピルフェニルジメトキシシラ ン、アーグリシドキシプロピルフェニルジエトキシシラ ンなどジアルコキシシランまたはジアシルオキシシラン 類、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テ トラーiso-プロポキシシラン、テトラーn-プロポ キシシラン、テトラーnープトキシシラン、テトラーs ecープトキシシラン、テトラーtertープトキシシ ラン、テトラペンタエトキシシラン、テトラペンターi

シシラン、テトラペンターn-ブトキシシラン、テトラーペンターs-e c-ブトキシシラン、テトラペンターtertーブトキシシラン、メチルトリプロポキシシラン、ジメチルエトキシシラン、ジメチルブロポキシシラン、ジメチルブロポキシシラン、ヘキシルトリメトキシシラン、ヘー(メタ)アクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン等の有機珪素化合物がその例である。

【0041】以上のような有機珪素化合物を部分的に加水分解して使用したり、あるいは部分的に加水分解し硬 10 化させて使用することも膜強度の面から好ましい。加水分解は純水または塩酸、酢酸あるいは硫酸などの酸性水溶液を添加、撹拌することによって達成される。さらに純水、あるいは酸性水溶液の添加量を調節することによって加水分解の度合をコントロールすることも容易に可能である。加水分解に際しては、加水分解性基と等モル以上、3倍モル以下の純水または酸性水溶液の添加が硬化促進の点で特に好ましい。

【0042】また、上記有機珪素化合物の構造において、R1、R2またはR3のいずれか1つ以上が重合性 20 官能基を有することが、膜の強度の面からより好ましく用いられる。さらに、R1、R2またはR3のいずれか1つ以上が、エポキシ基又はビニルエーテル基であることが高い反応性を有し熱または活性光線で容易に硬化し うる点でより好ましく用いられる。

【0043】 このようなエポキシ基を有する有機珪素化 合物の例としては、硬化した後高い硬度が得られるため 以下のものが好ましく用いられる。

[0044]

(Ep-CH20(CH2)。), SiR5, (R6)、(OR7)、-(rrs, +t) ただし、R5、R6は炭素、水素、酸素又はフッ素原子を含む有機基を、R7は加水分解性基を、 $q=0\sim2$ 、r=0または1、s=0または1、t=0または1の整数をそれぞれ表す。

【0045】ビニル基を有する有機珪素化合物の例としては、硬化した後高い硬度が得られるため、以下のものが好ましく用いられる。

[0046]

(CH2=CRO(CH2)₁)_a Si(R8)_n (R9)_n (OR10)_{n-(a+n+p)} ただし、R8、R9は炭素、水素、酸素又はフッ素原子 40 を含む有機基を、R10は脂肪族、脂環族、芳香族残基 を、1は0~4、mは0~3、nは0~3、pは0~3 の整数をそれぞれ表す。

[0047] とれら有機珪素化合物は通常熱による硬化法が用いられる。硬化速度を早める目的で、カルボン酸のアルカリ金属塩やアルミニウム、チタン、ジルコニウムなどの各種金属アルコキシドあるいはキレート化合物の使用があげられる。

【0048】有機珪素化合物とエポキシ化合物が併用さ のが好ましく、無機系の、少なくともSi、Al、S れる場合は、硬化剤として、アルミニウム、チタン、ジ 50 n、Sb、Zn、Tiから選ばれる1種以上の元素を含

16

ルコニウム、鉄、銅などの各種金属キレート化合物を用いると、両者を同時に硬化できるので好ましい。— 【0049】 これら硬化剤の中でも金属キレート化合物が好適に用いることができ、特に塗料の安定性等の点から下記に示すアルミニウムキレート化合物が有用であ

【0050】ここでいうアルミニウムキレート化合物とは、例えば一般式AlX,Y,_,で示されるアルミニウムキレート化合物である。

【0051】ただし式中、XはOL(Lは低級アルキル基)、Yは一般式M¹COCH,COM²(M¹、M²(はいずれも低級アルキル基)で示される化合物に由来する配位子及び一般式M¹COCH,COOM¹(M¹、M¹はいずれも低級アルキル基)で示される化合物に由来する配位子から選ばれる少なくとも1つであり、nは0、1または2である。

【0052】一般式A1X_nY_{n-n}で示されるアルミニウムキレート化合物としては、各種化合物を挙げうるが、組成物への溶解性、安定性等の観点から特に好ましいのは、アルミニウムアセチルアセトネート、アルミニウムージーnーブトキシドモノエチルアセトアセテート、アルミニウムージーisoープロボキシドモノエチルアセトアセテートなどである。これらは2種以上を混合して使用することも可能である。その際幹料の貯蔵安定性の点から、塗料溶剤中にアセチルアセトンを加えることもできる。その他、各種エボキシ樹脂硬化剤、あるいは各種有機珪素樹脂硬化剤等が使用されるが、これらの化合物はエボキシ化合物と、有機珪素化合物化合物の合計100重量部に対し、0.1~20重量程度が用いられる。

【0053】また、このようなフッ素化合物および有機 珪素化合物を主成分とするバインダー樹脂に微粒子を添 加することによって膜中に空気によるミクロ空隙を形成 させ、屈折率を低下させることも可能である。バインダ 一成分として好ましいのは、フッ素化合物1~99重量 部、有機珪素化合物99~1重量部である。より好まし くは、フッ素化合物10~90重量部、有機珪素化合物 90~10重量部である。 さらに好ましくはフッ素化合 物20~80量部、有機珪素化合物80~20重量部で ある。フッ素化合物が10重量部未満では空気層による 屈折率の低下がほとんど見られない傾向にあり、また9 0 重量部を越えると膜の強度が不足する傾向があるため である。また、膜中に空気によるミクロ空隙を形成させ た際、表面に凹凸が形成されるため含フッ素シラン化合 物を含有する組成物のコーティング被膜との密着性が向 上するため好ましい。このような低屈折率膜に用いられ る微粒子としては、それ自体が比較的低屈折率であるも のが好ましく、無機系の、少なくともSi、Al、S

(10)

む酸化物かフッ化マグネシウム、フッ化カルシウム及び 有機系のエマルジョン粒子が挙げられる。好ましいのは 無機系の微粒子である。さらに、該微粒子のBET法で 測定した平均粒径は好ましくは1 n m以上、100 n m 以下、さらに好ましくは5~40nmである。平均粒径 100nmを超えると形成された膜のヘイズが大きくな り、透明性が劣る傾向がある。これら粒子の使用に際し ては、通常ゾルの形態で用いるが、より分散性の高いゾ ルを得るためには、通常は、水、アルコール、エステ ル、炭化水素などの分散媒に分散させたものを用いる。 これらの微粒子は、低屈折率膜中のバインダー樹脂10 0重量部に対し、好ましくは5重量部~200重量部、 さらに好ましくは15重量部~150重量部加えられ る。 微粒子の量がバインダー樹脂100重量部に対し5 重量部未満または、150重量部よりも多い場合はボイ ドができにくく、屈折率の低下が見られなくなる傾向が ある。

17

【0054】以上のような低屈折率光学薄膜をハードコ ート膜の上に形成させることは耐擦傷性、反射防止作用 などの点からから好ましい。反射防止作用は、屈折率の 20 異なる多層の膜を積層することにより性能が高められる ことが知られている。多層の積層膜の構成膜としてハー ドコート膜用いる場合は、有機系光学薄膜の下層として 該低屈折率膜よりも高屈折率のハードコート膜を設ける ととが好ましい。との場合、高屈折率ハードコート膜の 屈折率が、20℃においてD線で測定した値で1.56 以上、好ましくは1. 6以上であることが求められる。 【0055】高屈折率ハードコート膜は、有機または無 機バインダーあるいは両者の混合系バインダーに、酸化 アンチモン、酸化セレン、酸化チタン、酸化スズ、アン 30 チモンドープ酸化スズ、リンドープ酸化スズ、酸化亜 鉛、アンチモン酸亜鉛、スズドーブ酸化インジウムなど の屈折率の高い金属化合物超微粒子を分散させた膜を形 成することにより得る。本発明を限定するものでない が、有機バインダーとしては、エポキシ樹脂硬化物やラ ジカル架橋重合した樹脂などが、無機系パインダーとし ては、シラン系化合物の加水分解硬化物などが用いられ

【0056】高屈折率ハードコート膜に導電性を有する無機酸化物微粒子を固形分全体に対し好ましくは40~4090重量%、さらに好ましくは50~80重量%分散させることにより導電性の高屈折率ハードコート膜とすることができる。その際、10°~10Q/□程度の導電性があれば、反射防止性物品に帯電防止機能や、さらには電磁波遮断機能が付与できる。無機酸化微粒子が40重量%未満では導電性が不足し、また90重量%を越えると被膜の強度が低下する傾向がある。このような無機酸化微粒子としてはスズ、インジウム、アンチモン、亜鉛の群の中から選ばれる成分を含有しているものがあげられる。例えば酸化アンチモン、酸化セレン、酸化チ50

タン、酸化スズ、アンチモンドープ酸化スズ、リンドープ酸化スズ、酸化亜鉛、アンチモン酸亜鉛、スズドープ酸化インジウムなどがあげられるが、特にアンチモン酸亜鉛が帯電防止性、膜の透過率の点から好ましい。

【0057】また、高屈折率ハードコート層に微粒子を分散させて表面に凹凸を形成させ表面光沢を減少することも反射防止の面から好ましい。このような表面に凹凸を形成させ表面光沢を減少させる微粒子としては、平均粒子径または2次粒子径が1μm~7μmの微粒子で、1μm未満だと表面光沢が減少せず、7μmを越えると透過率が悪くなる。微粒子は固形分全体に対し好ましくは1~10重量%、さらに好ましくは2~8重量%分散させる。微粒子が1重量%未満だと光沢が減少しにくく、また10重量%を越えると透過率が悪くなる傾向がある。微粒子としてはシリカ、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、炭酸カルシウムなど無機化合物微粒子あるいは有機化合物の球状微粒子などがあげられる。特にシリカ微粒子は低屈折率光学薄膜との密着性の点から好ましい。

【0058】また、上記の導電性を有する無機酸化微粒子と凹凸を形成し表面光沢を減少するような無機化合物 微粒子を2種類以上分散させ帯電防止性能を有する防眩性導電性膜とするのも有効である。

【0059】本発明に使用される有機系皮膜を形成する際に使用する溶媒としてはアルコール系、エステル系、エーテルアルコール系、ケトン系、炭化水素系、芳香族系溶剤やジメチルホルムアミド(DMF)などの高極性溶剤、場合によってはそれらに少量の水を含む溶剤など特に限定されないが、溶解性や均一コーティング性の観点から選ばれる単独または混合系の溶剤に、均一に分散または溶解され、塗料となる。塗料にはコーティングの均一性と密着性向上のために、界面活性剤、レベリング剤、カッブリング剤、ボリマー類等を加えることもできる。

【0060】以上のようにして調製した塗料をコーティングする方法としては、スピンコート法、ディップ法、ダイコート法、バーコート法、スプレー法、ロールコート法、メニスカスコーター法、フレキソ印刷法、スクリーン印刷法、ビードコーター法等があげられる。

【0061】また、有機系被膜と含フッ素シラン化合物 を含有する組成物のコーティング被膜との密着性をあげるためにプラズマ放電やコロナ放電などの処理を行い表 面性質を改質することも耐擦傷性を向上させるために有効である。

[0062]

【実施例】次に実施例を挙げて、本発明を具体的に説明するが、これに限定されるものではない。なお、以下の実施例及び参考例において用いた評価手段及び測定手段は次の通りである。

0 【0063】a. 指紋の拭き取り性:表面に指を3秒間

押しつけて、指紋を付着させ、ティッシュペーパーを往 復させて指紋を拭き取り、指紋の拭き取り易さを判定し ---- 旭化成製)-を2-K-g-/-c-m¹荷重で100往復する。判定 た。判定基準は以下の通り。

[0064]

A:10回程度で指紋が完全に拭き取れる B:20回程度で指紋が完全に拭き取れる

C:30回程度で拭き取れる D:30回以上で拭き残しあり

E:全くとれない

b. スチールウール (SW) 硬度: スチールウール#0 10 製した。

000番を使用し、2

50g/cm²荷重で10往復する。判定基準は以下の通

ŋ.

〇: 傷無し

△:傷が数本ある

×:傷あり

××:表面がはがれる

* c. 耐擦傷性: クリーニングクロス (ベンコットM3:

基進は以下の通り。

〇:変化無し

△:反射率、接触角に多少変化あり

×:反射色が変化する

××:剥離

d. 片面反射率:分光光度計による540nmにおける 反射率測定値次の参考例1~4に従い、有機系被膜を調

【0065】(参考例1)厚さ80µmのトリアセチル セルロースフィルム (富士写真フィルム社製"フジタッ ク")の片面に、固形分濃度20重量%の下記組成塗料 をグラビアコートし、130℃で5分間加熱後、UVを

1000mJ照射して導電性ハードコート膜を形成し

[0066]

セルナックスCXZ-300M1F(日産化学社製、

230重量部

アンチモン酸亜鉛を30重量%含むメタノールゾル)

エピコート828 (油化シェルエポキシ(株)製)

15重量部

γ - グリシドキシプロビルトリメトキシシラン加水分解物

15重量部

SI-100L (三新化学社製 光硬化剤) アルミニウムアセチルアセトナート

1重量部 1重量部

得られたハードコート膜の膜厚はおよそ3μmであっ

【0067】(参考例2)参考例1と同様の方法でトリ アセチルセルロースフィルム上に導電性ハードコートを 形成した後、下記組成を用いて有機溶媒により固形分濃※ ※度1.5重量%の塗料を調製し、ハードコート上にグラ ビアコートし、脱溶媒後、UV硬化して低屈折率光学薄 膜を形成した。

[0068]

[1E8]

90重量部

トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル

10重量部

CI-2855 (カチオン重合開始剤、日本曹達(株)製)

6重量部

イソプロビルチオキサントン

1重量部

得られた低屈折率膜の膜厚は約80ヵmであり、屈折率 は1.41であった。

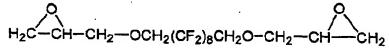
【0069】(参考例3)参考例1と同様の方法でトリ 40 加熱硬化して低屈折率光学薄膜を形成した。 アセチルセルロースフィルム上に導電性ハードコートを 設けた後、下記組成を用いて有機溶媒により固形分濃度

★ラビアコートし、脱溶媒後、130°Cの熱風オーブン中 で、基材が熱損傷を受けない時間内(約5分)の条件で

[0070]

【化9】

1. 5重量%の塗料を調製し、上記ハードコート上にグ★



50重量部

酸化珪素微粒子(平均粒子径10nm)

50重量部

γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン加水分解物

50重量部

アルミニウムアセチルアセトナート

-得られた低屈折率膜はミクロボイドを有し、膜厚は約8 0nmであり、屈折率は1.35であった。

【0071】(参考例4)厚さ80µmのトリアセチル セルロースフィルム(富士写真フィルム社製"フジタッ米

5重量部

1 重量部

* ク")の片面に、シリカを分散させた下記組成塗料をグ ラビアコートし、130度で5分間加熱後、UVを10 00mJ 照射して防眩性ハードコート膜を形成した。 [0072]

50重量部 エピコート827(油化シェルエポキシ(株)製) γ-グリシドキシプロビルトリメトキシシラン加水分解物 50重量部 シリカ微粒子 (平均粒子径3 μm) 5重量部 アルミニウムアセチルアセトナート 4重量部

SI-100L (三新化学工業 (株) 製 光硬化剤)

※1.5重量%の塗料を調製し、ハードコート上にグラビ アコートし、130度で5分加熱後後、UV硬化して低 屈折率光学薄膜を形成した。

[0074]

得られたハードコート膜の膜厚はおよそ3 μ m であっ た。

【0073】(参考例5)参考例4と同様の方法でトリ アセチルセルロースフィルム上に防眩性ハードコートを 設けた後、下記組成を用いて有機溶媒により固形分濃度※

CH, =CH-O-(CH,), -O-CH, -(CF,), -CH, -O-(CH,), -O-CH=CH,

90重量部

ラピキュアCHVE

(アイエスピージャパン(株)製 ビニルエーテル樹脂)

10重量部

SI-100MEK(三新化学工業(株)製 光開始剤)

5重量部

80nmであった。

【0075】(実施例1)パーフルオロオクチルエチル トリエトキシシラン100重量部に対し、0.1規定の 塩酸を9重量部添加し、室温で十分攪拌した後、パーフ ルオロヘキサンに希釈し0.1wt%の溶液とした。こ の溶液を参考例 1 で作成したフィルム上にスピンコート で塗布し、加熱乾燥して溶媒を蒸発させた後、一昼夜放 置し、含フッ素シラン化合物の被膜を形成させたフィル ムを得た。

上に実施例1と同様の方法で含フッ素シラン化合物の被 膜を形成させたフィルムを得た。

【0077】(実施例3)参考例3で作成したフィルム 上に実施例 1 と同様の方法で含フッ素シラン化合物の被 膜を形成させたフィルムを得た。

得られた低屈折率光学薄膜の屈折率は1.41、膜厚は 20★【0078】(実施例4)参考例4で作成したフィルム 上に実施例1と同様の方法で含フッ素シラン化合物の被 膜を形成させたフィルムを得た

> (実施例5)参考例5で作成したフィルム上に実施例1 と同様の方法で含フッ素シラン化合物の被膜を形成させ たフィルムを得た

(実施例6)下式で示されるパーフルオロポリエーテル シラン化合物 (ダイキン工業 (株)製:分子量1500 ~7500)をパーフルオロヘキサンに希釈し0.1w t%の溶液とした。この溶液を参考例1で作成したフィ 【0076】(実施例2)参考例2で作成したフィルム 30 ルム上にスピンコートで塗布し、加熱乾燥して溶媒を蒸 発させた後、一昼夜放置し、含フッ素シラン化合物の被 膜を形成させたフィルムを得た。

> [0079] 【化10】

$$C_3F_7$$
— $(OCF_2CF_2CF_2)_{5-40}$ — 0 — $(CF_2)_2$ — $(CH_2$ — CH — $)_{1-10}$ — H

$$S_1$$
— $(OCH_3)_3$

(実施例7)参考例2で作成したフィルム上に実施例6 と同様の方法で含フッ素シラン化合物の被膜を形成させ たフィルムを得た。

【0080】(実施例8)参考例3で作成したフィルム 上に実施例6と同様の方法で含フッ素シラン化合物の被 膜を形成させたフィルムを得た。

【0081】(実施例9)参考例4で作成したフィルム 上に実施例6と同様の方法で含フッ素シラン化合物の被 膜を形成させたフィルムを得た。

【0082】(実施例10)参考例5で作成したフィル ム上に実施例6と同様の方法で含フッ素シラン化合物の 50 ム上に実施例10と同様の方法で含フッ素シラン化合物

被膜を形成させたフィルムを得た。

【0083】(実施例11)実施例6で使用したパーフ ルオロポリエーテルシラン化合物5重量部に対し加水分 解したエチルシリケートを1部添加した後、パーフルオ ロヘキサンに希釈し0.1wt%の溶液とした。この溶 液を参考例1で作成したフィルム上にスピンコートで塗 布し、加熱乾燥して溶媒を蒸発させた後、一昼夜放置 し、含フッ素シラン化合物の被膜を形成させたフィルム を得た。

【0084】(実施例12)参考例2で作成したフィル

24

の被膜を形成させたフィルムを得た。

_____(_0_0_8_5_)_(実施例13)参考例3で作成したフィルム上に実施例10と同様の方法で含フッ素シラン化合物の被膜を形成させたフィルムを得た。

【0086】(実施例14)参考例4で作成したフィルム上に実施例10と同様の方法で含フッ素シラン化合物

. の被膜を形成させたフィルムを得た。

*【0087】(実施例15)参考例5で作成したフィルム上に実施例10と同様の方法で含フッ素シラン化合物の被膜を形成させたフィルムを得た。

【0088】それぞれの評価結果を表1に示した。

[0089]

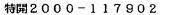
【表1】

		指数ふき取り性	SW视度	耐排傷性	片面反射率
					(%)
参考例	1	E	0	0	6. 0
	2 ·	D	· Δ	0	0.9
	3	E	0	0	0.6
	4	D	0	0	0.8
	5	D	Δ	0	0.7
実施例	. 1	B	Δ	0 .	5. 0
	2	С	Δ	0	0.9
	8	С	0	0	. 0. 7
	4	В	Δ	Δ	D. 8
	5	В	Δ	Δ	0.7
	6	Å	Δ	Δ	5. 0
	7	Α .	×	Δ	0.8
	8	В	Δ	Δ	1. 1
	9	В	Δ	0	0.7
	1 0	A	×	×	0. 7
	11	В	0	Δ	5. 0
	1 2	A	Δ	Δ	0. 9
	1 9	В	0	0	1. 0
	14	В	Δ	. 0	0.8
	1 5	A	×	Δ.	0. 7

[0090]

【発明の効果】汚れが付着しにくくかつ汚染物の除去が

容易なシートまたはフィルムを提供することを目的とする。



フロントページの続き

下ターム(参考) 2K009 AA02 AA15 BB14 BB24 BB28 CC33 CC42 EE03 EE05 4F071 AA22 AA30 AA37 AA42 AA65 AA67 AB06 AB10 AB15 AB18 AF22 AF31 AG12 AH12 BC01 4F100 AA088 AA188 AA198 AH008 AK178 AK528 AK53B AK54B CA028 DJ008 JN068 JN188 4J038 KA03 MA08 MA09 MA14 NA05 NA11 NA19 NA20 PA07 PA17 PA19 PB08 PC08